

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2007年3月1日 (01.03.2007)

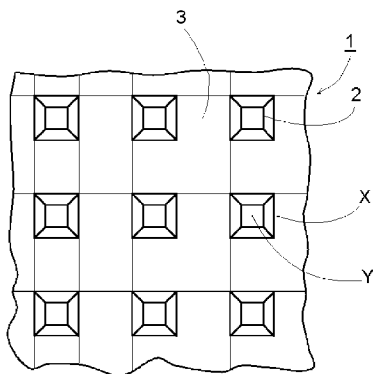
PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/023949 A1

- (51) 国際特許分類:
B24D 3/00 (2006.01) B24B 53/12 (2006.01)
B24B 37/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/316737
- (22) 国際出願日: 2006年8月25日 (25.08.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2005-243529 2005年8月25日 (25.08.2005) JP
特願2006-209236 2006年7月31日 (31.07.2006) JP
- (71) 出願人 および
(72) 発明者: 石塚 博 (ISHIZUKA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒1420063 東京都品川区荏原6丁目19番2号 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 葛和 清司 (KUZUWA, Kiyoshi); 〒1620067 東京都新宿区富久町8番21号 T & Tビル 葛和国际特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: TOOL WITH SINTERED BODY POLISHING SURFACE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

(54) 発明の名称: 焼結体研磨部を持つ工具およびその製造方法



(57) Abstract: An efficiently processible polishing tool, particularly used for a CMP pad conditioner, capable solving problems in a fixing strength for fixing abrasive grains to a base plate and problems in nonuniform polished surface and a method of effectively manufacturing the polishing tool. The polishing tool (1) comprises a polishing part formed of a super abrasive grain sintered body sintered integrally with the lining material of a cemented carbide. The polishing part comprises a plurality of polishing units (2) with top parts. The top parts are positioned on an approximately same plane. The polishing units (2) are formed by forming a linear groove (3) group in the polishing part.

(57) 要約:

砥粒の基板への固着強度問題や不均一な研磨面の問題等が解決された高能率で加工可能な研磨工具およびその効果的な製造方法を提供する。本発明は、超硬合金の裏打ち材に焼結一体化した超砥粒焼結体からなる研磨部をもつ研磨工具 (1) であって、研磨部が、頂部を有する複数の研磨単位 (2) を含み、各頂部が相互に略同一平面上にあり、研磨単位 (2) が、該研磨部に直線溝 (3) 群を設けることにより形成された、特にCMPパッドコンディショナーに用いられる前記研磨工具およびその製造方法に関する。